

香港新记载的三种蕨类植物

苏美灵

(香港浸会学院生物系, 香港九龙窝打老道 224 号)

NEW RECORDS OF FERNS IN HONG KONG

SU Mei-Ling(M.L.So)

(Biology Department, Hong Kong Baptist College, 224 Waterloo Road Hong Kong)

关键词 中华刺蕨, 细口团扇蕨, 南洋假脉蕨, 新记载

Key words *Egenolfia sinensis*, *Sphaerocionium nitidulum*, *Crepidomonas bipunctatum*, New record

香港虽然只不过是一个面积 1074 km² 的小地方, 但植物种类繁多。本地生的维管束植物已录得 1996 种, 新记录时有发现。香港地势多山, 山区占总面积约四分之三。由于大片郊区早已被指定为郊野公园, 严禁任意采摘, 所在在这 20 年间, 各郊区仍能保持不同的植物种类。新界的大埔坳自然保护区更是一片独特的地方, 因为它是唯一未受战争影响的树林, 林内有多条山溪, 以致在干旱的冬天, 也能保持固定的湿度。

根据香港渔农处所出版的《香港植物名录》蕨类植物有 180 种。H.H.Edie^[1] 只提及 175 种, 但亦特别指出某些种已多年未见过, 可能早已不存在。在过去一年多的实地考察中, 作者只能找到其中的 141 种, 不过却发现了新记载的 3 种蕨类。标本存香港浸会学院生物系标本室内。

中华刺蕨 *Egenolfia sinensis* (Bak.) Maxon

根据 Edie^[1] 记载, 本港只有 *Egenolfia appendiculata* (Willd.) J. Sm., 此种在一些溪石旁阴暗的地方均可以发现, 但仍属于少见的蕨。但中华刺蕨则发现于大埔坳 200 m 高的山溪旁一块巨石下的阴暗处, 并且只有两棵。

Egenolfia sinensis 和 *Bolbitis subcordata* 甚相似, 唯一不同乃后者顶生羽片成一尖长的三角形, 但前者之顶部有 8 对侧羽片。(So 93325)

细口团扇蕨 *Sphaerocionium nitidulum* (v.d.B) Iwat.

本种原被分类为 *Trichomanes nitidulum* v.d.B.PL.Jungh. Copeland^[2] 在 1938 年曾对此属进行一次大修正, 将之改为 *Microtrichomanes nitidulum* (v.d.B.) Copel.其后 K. Iwatsuki^[3,4] 在他对膜叶蕨科的分类详细分析 *Microtrichomanes* 内所有种类, 认为此种应属于 *Sphaerocionium*.

本种附生在阴湿的岩石上, 与其它苔藓植物混生。(So 93325 F, So 93131F)

南洋假脉蕨 *Crepidomonas bipunctatum* (Poir.) Copel.

本种是在高 600 m 瀑布旁阴湿岩石上生长, 十分罕见, 在其它同样生境未有发现。(So 94822 F)

结语

虽然香港人口密集, 可幸仍有大片地方被列入自然保护区, 动植物可以得到足够的保护, 相信仍有一些微细型蕨类植物等待发掘。

致谢 文中细口团扇蕨和南洋假脉蕨标本的鉴定, 得到菲律宾大学标本室何振忠的指导和帮助。中华刺蕨的鉴定得到中国科学院华南植物研究所吴兆洪教授指导。

参考文献

- [1] Edie H H. Ferns of Hong Kong. Hong Kong University Press. 1978.
- [2] Copeland E B. Genera Hymenophyllaceae. *Phil J Sc*, 1938, **67**: 1—110.
- [3] Iwatsuki K. Studies in the systematics of Filmy Ferns I. A Note on the Identity of *Microtrichomanes*. *Ferns Gaz*, 1975, **11**: 115—124.
- [4] Iwatsuki K. Studies in the systematics of Filmy Ferns VI. The Genus *Sphaerocionium* in Asia and Oceania. *J Fac Sci University Tokyo Sect. III*, 1982, **13**: 203—215.

* * * * *

(上接 220 页)

11. 质谱须注明所用的方法, 如(EIMS, CIMS, GC-MS, FABMS 等)及离解能, 只须给出分子离子峰及重要的特征碎片峰(相对强度), 如: EIMS(70eV m/z (%): 386[M⁺](36), 368[M-H₂O]⁺(100), 275[M-111]⁺(35)等。高分辨质谱(HRMS)若有必要可多给一些信息。

12. 紫外光谱表示法, 如 $UV \lambda_{\max}^{\text{EtOH}} \text{nm}(\lg \epsilon)$: 203(4.17)。

13. 红外光谱表示法, 如 $IR \nu_{\max}^{\text{KBr}} \text{cm}^{-1}$: 1740。官能团的指定放在圆括号内, 如: 1740(>C=O)。若要标明吸收带的强度, 则采用以下缩写符号: w (弱), m (中等), v (可变), s (强), vs (很强)。

14. 有机化合物和无机化合物及有关的缩写符号须规范化(参考 CA), 如氘代溶剂 CDCl₃, DMSO-d₅, D₂O, pyridine-d₅ 等。常见化学试剂在文中均以化学符号表示, 如: MeOH, EtOH, n-BuOH, PrOH, iso-PrOH, PhOH(苯酚), petrol (石油醚), CHCl₃, CCl₄, C₆C₆, Et₂O, Me₂CO, HOAc, EtOAc, THF, Ac₂O, NaOMe, CH₂N₂, HCO₂H(甲酸), TCA(三氯乙酸), TFA(三氟乙酸), NaOAc, NaOH, HCl, H₂SO₄, CO₂, H₃BO₃, NH₃, N₂ 等。

15. 制备薄层析须注明(1) 薄层厚度; (2) 样品的量; (3) 确定带的方法; (4) 从吸附剂上洗脱下化合物所用的溶剂。特殊 TLC 的吸附剂须注明, 如: AgNO₃-硅胶(1:9)。

16. 气相色谱(GC)须注明检测器(FID, EC 等), 载气及流速, 操作温度, 柱子情况等。

17. 高压液相(HPLC)须注明(1) 柱子情况, 如大小、型号; (2) 压力及溶剂; (3) 检测方法, 如 UV 或折光率。

18. X-衍射只须给出立体结构图(最好有键长)及必要的数字, 详细记录可指明在什么地方储存。